Краткие сообщения по физике № 11 1980

ВЛИЯНИЕ МИКРОВКЛЮЧЕНИЙ НА ОПТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ В СРЕДНЕМ ИК ДИАПАЗОНЕ

В. Г. Артюшенко, Е. М. Дианов

УДК 535.341

Измерены коэффициенты объемного и поверхностного поглощения излучения на длинах волн I,06, 5 + 6 и I0,6 мкм, а также коэффициенты рассеяния на I0,6 мкм в образцах промышленных кристаллов NaCl, KCl, KBr и Csi. Измеренные величины сопоставлены с концентрацией микровключений в кристаллах, определенной ультрамикроскопическим методом.

Проблема получения высокопрозрачных материалов для мощных инфракрасных лазеров привлекает к себе в последнее время большое внимание. Одним из классов таких материалов, в частности. являются шелочно-галоидные кристаллы (ШГК). В ряде работ /I - 4/ было показано, что фундаментальное многофононное поглощение в этих кристаллах в среднем ИК диапазоне экспоненциально убывает с ростом частоть. В получаемых сейчас ШТК экспериментально измеренные величины коэффициентов поглощения на длинах волн I,06, 5.25 и IO.6 мкм /I.3 - 5/, как правило, превышают уровень фундаментального поглощения, что обусловлено наличием в них поглощающих примесей. Концентрация примесей, приводящих к поглощению $\beta_{-} = 10^{-4} \text{ см}^{-1}$ на длине волны $\lambda = 10,6$ мкм, может быть чрезвычайно низкой (например, для КС1 достаточно 10-7% С10-7 /6/). На оптические потери также может существенно влиять форма вхождения примеси в кристалл. Одной из таких форм являются микровключения, в которых примесь находится в собственной фазе. В 1962 году авторы работы /7/ обнаружили с помощью ультрамикроскопии в кристаллах NaCl, KCl, KBr и LiF наличие отдельных микровключений размером от нескольких сотен до несколько тысяч ангстрем

77

с концентрацией от 10⁵ до 10⁷ см⁻³. По данным /7/, интенсивность рассеяния света в кристаллах в диапазоне 300 – 700 нм коррелировала с величиной концентрации микровключений в них.

В известной нам литературе не удалось обнаружить данных об измерениях зависимости коэффициентов поглощения и рассеяния в среднем ИК диапазоне от содержания микровключений в ШГК. Поэтому нами были измерены коэффициенты объемного и поверхностного поглощения на длинах волн 1,06, 5 + 6 и 10,6 мкм, а также коэффициент рассеяния на 10,6 мкм в кристаллах NaCl, KCl, KBr и Cal.

Била сделана оценка размеров и концентрации микровключений в этих кристаллах. Концентрация микровключений сопоставлена с коэффициентами рассеяния и объемного поглощения, а также с уровнем содержания примесей, определенным спектрофотометрическим методом.

Методика измерений. Спектры пропускания исследованных образцов ШТК были получены на спектрофотометре ИКС-29 с компенсацией поверхностного поглощения в опорном дуче тонкой пластинкой исследуемого материала /4/. Так как чувствительность в определении коэффициента поглощения из спектров пропускания повышается с увеличением плины образца, измерения производились на кристаллах длиной 1 = 10 см. Коэффициенты объемного и поверхностного поглощения измерялись методом лазерной калориметрии /8/ с использованием лазера YAG: Nd³⁺ ($\lambda = 1,06$ мкм), CO₂-лазера ЛГ-22 (л = 10,6 мкм) и отпаянного СО-лазера, работавшего при комнатной температуре и генерировавшего несколько десятков линий в диапазоне от 5 до 6 мкм. Для ультрамикроскопии мы использовали криптоновый лазер мощностью 200 мВт на длине волны 0,647 мкм в качестве источника освещения микровключений, которые наблодались под прямым углом к лучу с помощью микроскопа с фотонасадкой. Измерения рассеяния производились на длине волны $\lambda =$ = 10,6 мкм с использованием в качестве приемника излучения фотосопротивления HgCdTe, которое располагалось под прямым углом к лучу лазера. Для измерений использовались промышленные кристаллы NaCl, KBr, CsI M KCl.

<u>Результати.</u> В спектрах пропускания всех исследованных кристаллов, кроме образца КС1 №3, были обнаружены полосы примесного поглощения. Наиболее интенсивными были примесные полосы в Са1.

Таблица I

Коэффициенты объемного и и поверхностного и поглощения в образцах MaCl, KCl, KBr и Сві на длинах волн I,06, 546 и IO,6 мкм, а также коэффициенты рэлеевского рассеяния у на IO,6 мкм и концентрация микровключений. Величины минимальных измеренных взяты из работ /I,3,4,9,IO/.

Длина волны, мкм.	I,06			5 + 6			10,6					
Параметры образцов	104 p. cm-I		T.A.	10 ⁴ , cm ⁻¹		404.	10 ⁴		404	107×	Концентра-	
	ərci.	MEHEM. ƏRCII.	10'ß a	PRCI .	MEHEM.	IU / B	эксп.	SKCIL.	Teo').	Pa	CM-I	CM-3
NaC1	2,6	0,07	3,6	I,8	0,34	9	IO	II	II	65	2	-
RC1 N1	I3	0,07.	I3	I,9	0,02	2,7	12	0,7	0,7	6	4	10 ⁵
KC1 H2	17	0,07	6	2,5	0,02	2	18	0,7	0,7	Ĩ	IO	10^{5} + 10^{6}
KC1 N3	0,8	0,07	0,3	I,2	0,02	2	2,9	0,7	0,7	I,5	2	104
KBr	0,5	0,03	I,3	I,3	-	3,2	II	0,002	3,002	I,6	2	10 ⁴ + 10 ⁵
CsI	27	dise	53	6,2	-	I,4	140	-	-	55	40	10 ⁶

9

Идентификация этих полос показала наличие примесей so_4^2 , $1o_5^2$, $1o_6^2$ в области 7 – 20 мкм и ОН в области 2,5 – 3 мкм /6/. Менее интенсивными были полосн $co_5^2^2$, No_5^2 , No_2^2 и ОН в образце КС1 №2. Остальные кристалли имели слабые полосы примесного поглощения в области 7 – 12 мкм: в КС1 №1 – co^{2^2} , нсо $so_4^2^2$; в КВг – Вго $_5^2$, $cro_4^{2^2}$, $so_4^{2^2}$; в МаС1 – нсо $_5^2$, $so_4^{2^2}$. Козфиниенты поглощения, определенные из пропускания на длиневолны $\lambda = 10,6$ мкм, совпадали по порядку величины с результатами, полученными методом лазерной калориметрии для объемного поглощения. Поглощение для всех длин волн 1,06, 5 + 6 и 10,6 мкм обусловлено в основном примесями, так как измеренные значения существенно превышают фундаментальные пределы и величины, полученные на особо чистых кристаллах (см. табл. 1), которые выращивались в атмосфере СС1₄.

Ультрамикроскопическое исследование образцов показало наличие микровключений с размерами порядка $10^2 - 10^3$ Å при концентрациях $10^4 - 10^6$ см⁻³. Длина волны освещения $\lambda = 0,647$ мкм в несколько раз превышала размеры микровключений, поэтому они выглядели под микроскопом как светящиеся точки. Из-за дифракции на краю объектива точки были окружены концентрическими кольцами, диаметр которых увеличивался по мере смещения микровключения из фокальной плоскости (рис. I). В случае, когда два микровключе-



Рис. I. Микровключения в кристаллах ксl. Увеличение в 150 раз

IO

ния находились на расстоянии ~10 мкм, на дифракционные кольца накладывалась система интерференционных полос, перпендикулярных прямой, соединяющей микровключения (рис. 1). Мы нашли, что в образцах с высокой концентрацией микровключений (КС1 2 и Св1) микровключения имели размеры порядка ~10³ А и были распределены по объему относительно равномерно, а в образцах с меньшей концентрацией (КС1 %1, КС1 %3, КВт) микровключения размером порядка ~10² А в основном декорировали границы блоков и дислокаций.

Почти для всех исследованных нами образцов величины коэффициентов объемного поглощения и особенно, коэффициентов рассеяния коррелировали с концентрацией микровключений (табл. I). Исключением является образец MaCl, в котором не удалось обнаружить видимых микровключений. Это, по всей видамости, объясняется тем, что методом ультрамикроскопии на длине волны 0,647 мкм при экснозиции I мин можно обнаружить только достаточно крупные микровключения (более IOO Å). Более мелкие микровключения, конечно, участвуют в процессах поглощения и рассеяния излучения. То, что в виде крупных микровключений содержится только часть при-

меси, подтверждает тот факт, что изменение концентрации микровключений на порядок и более сопровождается изменением поглощения и рассеяния в образцах КС1 № 2 и № 3 всего в несколько раз. Хотя объемная доля крупных микровключений в исследованных нами кристаллах относительно невелика (при концентрации 10⁶ см⁻³ микровключений размером 10³ Å их объемная доля составляет 10⁻⁹ и не является

основной причиной примесного поглощения), она почти во всех образцах коррелирует с уровнем поглощения (табл. I), так как,

по-видимому, является характеристикой, отражающей общий уровень содержания примесей в исследованных образцах ШГК.

Крупные микровключения более существенно влияют на уровень рассеяния, так как он является квадратичной функцией объема рассеивающих центров. Что касается поверхностного рассеяния на исследованных образцах, то наши измерения показали, что оно существенно превышает уровень объемного рассеяныя в отличие от рассеяния в видимом диапазоне. Это объясняется различной зависимостью коэффициентов объемного и поверхностного поглощения от длины волны. Поверхностное поглощение (табл. I) обусловлено.

II

по-видимому, загрязнением поверхности в процессе обработки и адсорбщией воды. Поверхности скола (образцы КС1 №2 и №3) имели в основном более низкий уровень поверхностного поглощения, чем оптически полированные (остальные образцы).

> Поступила в редакцию 27 мая 1980 г.

Литература

1. B.	Bendow.	J. Electr.	Mater.,	3. N	1.	101	(1974).
-------	---------	------------	---------	------	----	-----	---------

- 2. T. C. McGill, Opt. Prop. of Highly Transp. Sol., Plenum Press, N.-Y., 1975, p. 3.
- 3. M. Hass, B. Bendow, Appl. Opt., 16, 2882 (1977).
- 4. T. F. Deutsch, J. Phys. Chem. Sol., 34, 2091 (1973).

5. Е. С. Букова и др., ОМП, № 12, 29 (1977).

- 6. M. Flannery, M. Sparks, Proc. of Simp. "Laser Induced Damage in Opt. Mater.", NBS Boulder, Colorado, 1977.
- K. G. Bansigir, E. E. Schneider, J. Appl. Phys., Suppl., <u>33</u>, 383 (1962).
- 8. В. Г. Арткшенко, Е. М. Дианов, Е. П. Никитин, Квантовая электроника, 5, № 5, 1065 (1978).

9. S. D. Allen, J. E. Rudisill, Appl. Opt., <u>16</u>, 2914 (1977).
10. S. D. Allen, J. A. Harrington, Appl. Opt., <u>17</u>, 1679 (1978).
11. H. E. Bennet, Opt. Eng., <u>17</u>, 480 (1978).